Japanese Patent Application Publication No. S55-47582

Publication Date: December 1, 1980

Application No.: S52-63378 Application Date: June 1, 1977

Applicant: HITACHI METALS, LTD.

TITLE: LAMINATING METHOD OF AMORPHOUS ALLOY

Translation of Claim 1

A laminating method of an amorphous alloy, comprising: coating an adhesive on one side or both sides of a thin plate of an amorphous alloy before the plate is cut or punched;

then laminating at the same time as the cutting or punching, and thereafter, curing the adhesive while a pressure is applied.

载 (B2) 特 許 公

昭55-47582

(51) Int.Cl.3 B 32 B 15/00 /B 32 B 31/10 識別記号

庁内整理番号 6681 - 4 F7179-4F

244公告 昭和55年(1980) 12月 1日

発明の数 1

(全3頁)

1

匈アモルフアス合金の積層方法

願 昭52-63378 ②)特

②出 願 昭52(1977)6月1日

開 昭53-149855 公

43昭53(1978)12月27日

明 者 宮崎健 72発

> 熊谷市三尻 5200 番地日立金属株 式会社磁性材料研究所内

願 人 日立金属株式会社 勿出

東京都千代田区丸ノ内2丁目1番

2号

個代 理 人 弁理士 薄田利幸

の特許請求の範囲

1 アモルフアス合金の薄板を切断もしくは打抜 く前に接着剤をその片面もしくは両面に塗布し、 次いで切断もしくは打抜きと同時に積層し、その 後圧力をかけながら接着剤を硬化せしめることを 特徴とするアモルフアス合金の積層方法。

- 2 特許請求の範囲第1項記載の方法において、 積層を必要とする枚数ごとに剝離剤等を塗布した スペーサ、もしくは上記接着剤とは接着しない材 質からなるスペーサーを介在させ、多数個同時に 接着剤を硬化せしめることを特徴とするアモルフ 25 得られており、このため、通常 3 0~ 5 0 μm程 アス合金の積層方法。
- 3 特許請求の範囲第1項の記載の方法において 接着剤は片面のみに塗布し、積層を必要とする枚 数ごとに反対側の面に剝離剤を事前にもしくは打 抜き切断直前に塗布し、多数個同時に接着剤を硬 30 の後積層するが、これは少なくとも800℃以上 化せしめることを特徴とするアモルフアス合金の 積層方法。

発明の詳細な説明

本発明は、高透磁率アモルフアス合金に関する ものであり、特にアモルフアス合金薄板の積層方 35 いられる。ところがアモルフアス磁性材料はいわ 法に関するものである。

高透磁率金属材料としては、従来からFe-

Si合金、Fe-Ni合金、Fe-Si-A1合 金、その他各種の合金があり、それぞれの特性に 応じて多くの分野で使用されているが、応用分野 によつては必ずしも満足できるものとは限らない。

2

- 5 このため、従来用いられている高透磁率金属材料 が有する諸欠点のない新規な高透磁率合金として アモルフアス合金が提案されている。 通常金属は 固体状態では結晶状態であるが、ある特殊な条件 下では固体状態でも液体に類似した結晶構造をも 10 たない原子構造が得られる。このような金属はア モルファス金属又は非晶質金属と呼ばれるが、ア モルフアス合金の中にはその成分組成によつて特 に機械特性、耐食性に優れ、かつ極めて優れた透 磁性を有するものがあることが知られている(例
- 15 えば特開昭 5 1 6 5 3 9 5 号公報、特開昭 5 1 -73920号公報、特開昭51-73923号 公報)。また、該アモルフアス合金の特長を生か し、アモルフアス合金で磁気回路を構成すること により耐摩耗性、磁気特性および高周波特性にお 20 いて優れた磁気ヘツドも提案されている(特開昭 51-94211号公報)。

上記アモルフアス合金は現在、原料金属を加熱 溶解し、該溶融金属を不活性雰囲気下で高速回転 する回転ドラム内面に噴射させ、超高速冷却して 度の薄板状でしか得られない。従つて該合金を応 用し磁気ヘッド等を工業的に実現するためには、 該合金に適した積層技術が要求される。従来の軟 質磁性材料では最終形状に加工後磁性焼鈍をしそ で十分焼鈍し磁性を出させるためであり、例えば パーマロイの磁心あるいは磁気へツドコアは

1000~1100℃で溶体化しその後制御冷却 を行ない高い透磁率を付与し、その後積層して用 ゆる500℃以上の高温焼鈍は必要としないもの であり、熱安定化処理のため100℃以上望むら

3

くは200℃以上で短時間保持する必要がある。 このため、アモルフアス合金を積層して用いる場 合には、例えば特開昭51-94211号公報記 載の如く、アモルフアス合金を熱硬化性樹脂を用 いて接着積層し、次いで砥石研摩等にて所定の形 5 移動しつつ、矢印 6 方向に一定圧力を加えること 状に研磨加工し磁気コア等を製作している。

しかしながら、上記方法では積層後所定の形状 に研磨加工するため、加工効率が悪く、また加工 による影響を受け易いという欠点がある。

率アモルフアス合金に適した積層方法を提供する ことを目的とし、該目的を達成するために、本発 明は薄板アモルフアス磁性材料に接着剤を塗布し た後、打抜きプレスを行うと同時に積層し、適当 前記接着剤を硬化し積層することを特徴とする方 法である。

第1図は本発明方法の概略説明図である。図に おいて 1 は高透磁率アモルフアス合金の薄板であ り、2は上パンチ、3はダイスである。上パンチ 20 おいては熱処理が不用であることに着眼し、プレ 2を矢印 4方向に移動することによりアモルフア ス合金1を所定の形状に打抜く。打抜かれたアモ ルフアス合金5は一定圧力で矢印6方向におさえ られている押えガイド7上に載積する。このとき、 アモルフアス合金1には、プレス打抜き前にあら 25 極めて良好な磁気ヘツドコアあるいは磁小等が効 かじめ接着剤 8 が塗布されているため、打抜かれ たアモルフアス合金5は相互に接着剤8の粘性に より仮接合する。打抜かれたアモルフアス合金5 の枚数が所定の数量に達したら、該積層されたア モルフアス合金5を押えガイド7から取りはずし、30 その積み上げ方向上下から圧力を加えながら接着 剤8を硬化させ、磁気ヘツドコアあるいは磁心な

どを得る。上記構成において、押えガイド7を矢 印 6 方向に一定力でおさえるには油圧シリンダ、 リンアモータ等公知の手段によれば、積層厚が増 大するに従い矢印6と反対方向に押えガイド7が ができる。

また、本発明においては、積層枚数が少ないも のの場合には適当枚数打抜き後、第2図に示す如 く剝離剤 9を塗布したスペーサー10を介在させ 本発明は上記公知の方法の欠点を排除し高透磁 10 該スペーサ 1 0 とアモルフアス合金 1 を同時に打 抜きさらにその上にアモルフアス合金5を打抜積 層し、所定の厚さになつたときに押えガイド**7**か ら取り出すことにより多数の積層品を連続的に製 作するため段取時間を減少することが可能である。 な積厚の粗材を得、該粗材を圧接せしめた状態で 15 さらにまた、本発明において、接着剤に少量の減 磨材を添加することは、型寿命を延ばし、積度良 い打抜きができることから極めて有効である。

> 以上詳述した如く、本発明は、従来の高透磁率 合金とは異り、高透磁率アモルフアス磁性合金に ス打抜き前に接着剤を塗布することにより、打抜 かれた合金がバラバラに散逸することを防止する とともに、接着剤硬化後は仕上研磨程度の加工を 施すのみで良いからその特性を最大限に発揮でき、 率良く実現できる。

図面の簡単な説明

第1図および第2図は本発明方法の概略説明図

1……アモルフアス合金、2……上パンチ、3 ······ダイス、**7**······押えガイド、**10**·····スペー サ。

